PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-126071

(43) Date of publication of application: 27.04.1992

(51)Int.Cl.

C12M 3/00 C12N 5/06 C12N 11/00

(21)Application number: 02-248454

(71)Applicant: KAO CORP

TOKYO JIYOSHI IKA UNIV

(22)Date of filing:

17.09.1990

(72)Inventor: OKANO MITSUO

YAMADA NORIKO SAKURAI YASUHISA SAKAI HIDEAKI

NAKAMURA KOICHI

(54) CARRIER FOR CELL CULTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the subject carrier capable of separating and recovering cultured cells from the surface of a base material without requirement of using a protease, a chemical reagent, etc., by coating the surface of the base material with a polymer containing cell-bonding groups and having a critical solution temperature to water within a prescribed range. CONSTITUTION: A polymer containing cell-bonding groups such as an ionic group (e.g. carboxylate group or sulfonate group) or an ion forming group (e.g. amidation group or esterification group) and having 0–80° C critical solution temperature to water is prepared. As preferable examples of the polymer, an N-isopropylacrylamide/ sodium acrylate copolymer is exemplified. With the above-mentioned polymer, the surface of a base material is then coated utilizing a chemical reaction or a physical interaction, thus producing the objective carrier for cell culture. By culturing and growing cells using the resultant carrier, cultured cells cane readily be separated and recovered from the carrier.

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-126071

⑤Int. CI. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)4月27日

C 12 M 3/00 C 12 N 5/06 11/00

)6)6 9050-4B

2121-4B

7236-4B C 12 N 5/00

Ε

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全9頁)

知発明の名称 細胞培養用支持体

②特 願 平2-248454

Z

②出 願 平2(1990)9月17日

@発明者 岡

光夫

千葉県市川市国府台6-12-12

@発 明 者

山 田 桜 井

野

則子

東京都板橋区前野町6-10 前野町ハイツ1-601

⑩発明者 桜

靖 久

東京都杉並区永福3-17-6

⑩発 明 者 坂 井

秀 昭

和歌山県那賀郡岩出町畑毛310-3 フレグランス畑毛210

@発明者中村

浩 一

葆

和歌山県和歌山市園部1030-15

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

⑩出 願 人 花 王 株 式 会 社⑪出 願 人 学校法人東京女子医科

東京都新宿区河田町8-1

大学

個代 理 人 弁理士 青山

外2名

明細書

1. 発明の名称

細胞培養用支持体

2. 特許請求の範囲

- 1.細胞付着性基を有し且つ水に対する臨界溶解温度が0~80℃であるポリマーを、基材表面上に被覆してなる事を特徴とする細胞培養用支持体。
- 2. 細胞付着性基がイオン性基及び又はイオン 生成基である請求項」記載の細胞培養用支持体。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、生化学、医学および免疫学等における細胞類の培養用支持体に関するものである。

[従来の技術]

従来細胞培養は、ガラス裏面上あるいは種々の 処理を行った合成高分子材料の表面上にて行われ ていた。例えば、ポリスチレンを材料とする表面 処理(例えばて線照射、シリコンコーティング等) を行った種々の容器が、細胞培養用支持体として 替及している。従来、このような細胞培養用支持体を用いて培養・増殖した細胞は、トリブシンのような蛋白分解酵素や化学薬品により処理することで支持体表面から剥離・回収されていた。

しかしながら、上述のような処理を施して増殖 した細胞を回収する場合、①処理工程が煩雑にな り、不純物混入の可能性が多くなること、②増殖 した細胞が上記処理により変性し、細胞本来の機 能が損なわれる例があること、等の欠点が指摘さ れている。

そこで本発明者等は上記欠点を解消するために、 トリブシンやEDTAのような蛋白分解酵素や化 学薬品等による処理を施さずに、環境温度を変化 させるだけで、培養・増殖させた細胞を支持体表 面から剥離・回収することが可能な細胞培養に使 用する支持体材料を以前に提案した(特額平) -31844号)。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、上記出顧の発明を更に発展させ、細 胞の剥離・回収がより効果的に行える細胞培養用 支持体を提供することを、目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、基材上を或る種のボリマーで処理した細胞培養用支持体を使用すれば、より多くの細胞を培養出来、且つ温度を変化させるだけでその培養細胞を容易に回収することが可能であり、しかもこの回収操作は細胞を培養した培養液中においても可能であり、さらにその剥離した細胞は集合状態を保持していることを見出し、本発明を成すに至った。

即ち本発明は、細胞付着性基を有し且つ水に対する臨界溶解温度が0~80°Cであるポリマーを、基材表面上に被覆してなる事を特徴とする細胞培養用支持体を提供する。

本発明の細胞培養用支持体(以下単に、「支持体」と言うこともある。)は、ポリマーを基材表面上に被覆することにより形成される。このポリマーは、官能基として細胞付着性基を有することを特徴とする。「細胞付着性基」とは、培養しようとする細胞を容易に効果的に支持体に付着させ、それ

により、より多くの細胞を増殖培養させるもので ある。

そのような細胞付着性基としては、例えばイオ ン性基及びイオン生成基等が挙げられる。イオン 性基としては、例えば陰イオン性基及び陽イオン 性基等が挙げられる。陰イオン性基としては例え ば酸性基の塩等が挙げられ、又陽イオン性基とし ては塩基性基の塩等が挙げられる。酸性基として は、具体的にはカルボン酸基、スルホン酸基、リ ン酸基等が挙げられる。これらの塩としては、例 えばアルカリ金属塩(例えばNa塩、K塩等)、ア ルカリ土類金属塩(例えばMg塩、Ca塩等)、アン モニウム塩等が挙げられる。塩蒸性基としては、 具体的には1級、2級、3級アミノ基等が挙げら れる。これらの塩としては、鉱酸塩(例えば塩酸 塩、硫酸塩等)、有機酸塩(例えば酢酸塩、コハク 酸塩等)、及び4級アンモニウム基(例えば、テト ラメチルアンモニウム基等)が挙げられる。イオ ン生成基としては、例えば上記の酸性基、塩基性 基の他に、上記酸性基の酸無水物化基、アミド化

基及びエステル化基等が挙げられ、更にヒドロキシル基等も含まれる。 その他の細胞付着性基としては、例えばアルキル基(特に長鎖アルキル基、例えばステアリル基、ラウリル基等)、メルカブト基、エーテル基、チオエーテル基、ボリエーテル基、ケトン基、アルデヒド基、アシル基、シアノ基、ハロゲン基、グリシジル基、アリル基等が挙げられる。 上記細胞付着性基は、1種以上ポリマー中に存在してもよい。尚、複数種が存在する場合、それらはそれぞれの基がポリマー中に単独で存在してもよいし、或るいはそれらが同一の置換基中に存在した複合基(例えばベタイン基等)としてポリマー中に存在してもよい。

更に、基材表面上に被覆するのに使用する本発明のポリマーは水に対する臨界容解温度が 0~8 0℃である事も特徴とする。尚「臨界啓解温度」とは、2 層分離している2種の物質が或る温度になると互いに完全容解し均一層となるその温度のことを言う。特に、温度を上げて完全容解に達する

場合の温度を「上限臨界府解温度」、 温度を下げて完全府解する場合の温度を「下限臨界府解温度」と言うことがある。水に対する臨界府解温度は通常、水(イオン交換水または蒸留水)との府解相図を作成して求める。水との溶解相図は臨界府解温度を求めるポリマーの種々の濃度(重量分率、 容積分率、 モル分率、 モル比等いずれの単位を用いても構わない。)の水溶液を網製し、 各々の温度を上下させ、①目視により 2 相分離を確認する方法の他、②臨界タンパク光の觀測による方法、③散乱光強度の観測による方法、④透過レーザー光の觀測による方法等一般に知られている方法のいずれかを用いて、また、組み合わせて用いて作成される

本発明に用いるポリマーの水に対する臨界格解 温度は、0~80℃、より好ましくは0~50℃ である。臨界格解温度が80℃を魅えると細胞が 死滅する可能性があるので好ましくない。また臨 界格解温度が0℃より低いと、一般に細胞増殖速 度が極度に低下するか、または細胞が死滅してし まうため好ましくない。

そのような本発明に用いるポリマーは、主モノ マーと従モノマーを共重合して得られる。主モノ マーは、ポリマーの臨界溶解温度をほぼ決定する ものである。従ってそのような主モノマーは、そ の単独重合体の下限臨界溶解温度が0~80℃で あるもの、或るいは上限臨界裕解温度が0~80 ℃であるものが好ましい。そのような主モノマー の具体例としては例えば、アクリルアミド、メタ クリルアミドなどの(メタ)アクリルアミド化合物、 N-エチルアクリルアミド(単独重合体の下限臨 界溶解温度72℃)、N-n-プロピルアクリルア ミド(問21°C)、N-n-プロピルメタクリルア ミド(同27℃)、N-イソプロピルアクリルアミ ド(同32℃)、N-イソプロピルメタクリルアミ ド(同43°C)、N-シクロプロピルアクリルアミ ド(同 4 5 °C)、N - シクロプロピルメタクリルア ミド(同60℃)、N-エトキシエチルアクリルア ミド(同約35°C)、N-エトキシエチルメタクリ ルアミド(同約45℃)、Nーテトラヒドロフルフ

リルアクリルアミド(同約28°C)、Nーテトラヒ ドロフルフリルメタクリルアミド(同約35℃)等 のN-アルキル置換(メタ)アクリルアミド誘導体、 N-エチル-N-メチルアクリルアミド(単独重 合体の下限臨界容解温度56℃)、N,N-ジエチ ルアクリルアミド(同32℃)等のN,N-ジアル キル쮵換(メタ)アクリルアミド誘導体、さらに、 N-アクリロイルピロリジン(単独重合体の下限 臨界溶解温度56℃)、N-アクリロイルピペリ ジン(同約6℃)等を代表とする1-(1-オキソ - 2 - プロペニル) - ピロリジン類、 1 -() - オ キソー2-プロペニル)-ピペリジン類、4-(1 - オキソー 2 - プロペニル) - モルホリン、 l -(l - オキソー2-メチル-2-プロペニル)-ピロ リジン、1-(1-オキソー2-メチルー2ープ ロベニル)-ピペリジン、4-(1-オキソー2-メチルー2-プロペニル)-モルホリン等のよう な環状基を有する(メタ)アクリルアミド誘導体、 メチルビニルエーテル(単独重合体の下限臨界裔 解温度35℃)等のビニルエーテル誘導体等が挙

げられ、これらの1種以上を使用してよい。

従モノマーは、ポリマー中の前記細胞付着性基 の導入根拠となるもので、前記細胞付着性基を有 する共重合性モノマーが好ましい。そのような従 モノマーの具体例としては例えばアクリル酸、メ タクリル酸、2-メタクリロキシエチルコハク酸、 2-メタクリロキシエチルマレイン酸、2-メタ クリロキシエチルフタル酸、2-メタクリロキシ エチルヘキサヒドロフタル酸等で挙げられるよう なカルポン酸基、その中和塩(例えばアルカリ(土 類)金属塩)基、及び酸無水物基含有モノマー;ス チレンスルホン酸、2-アクリルアミドー2-メ チルプロパンスルホン酸、メタクリル酸2-スル ホエチル、アクリル酸3-スルホプロピルエステ ル等で挙げられるようなスルホン酸基、その中和 塩基、スルホン酸エステル基、及びスルホン酸ア ミド基含有モノマー;アクリロキシエチルフォス フェート、メタクリロキシエチルフォスフェート、 メタクリロキシブロビルフォスフェート等で挙げ られるようなリン酸基及びその中和塩基含有モノ

マー;メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタ クリル酸ジエチルアミノエチル、メタクリル酸ジ エチルトリメチルアンモニウムクロライド、メタ クリル酸エチルジメチルアンモニウムペンジルク ロライド等で挙げられるようなアミノ甚及びその 中性化基含有モノマー;アクリル酸ヒドロキシエ チル、メタクリル酸ヒドロキシエチル、メタクリ ル酸ヒドロキシプロピル等で挙げられるような水 酸基含有モノマー;その他長鎖アルキル基、メル カプト基、エーテル基、チオエーテル基、ポリエ ーテル基、ケトン基、アルデヒド基、アシル基、 シアノ基、ニトロ基、アシルアミノ基、ハロゲン 基、グリシジル基、アリル基等を含有するモノマ ー;さらに、これらの細胞付着性基を同一モノマ -内に複合して含有するモノマー(例えば、N-(3 - スルホプロピル) - N - メタクリロキシエチル - N . N - ジメチルアンモニウムペタイン)等が挙 げられる。これらのうち、特にイオン性基又はイ オン生成基を有するモノマーが好ましい。本発明 ではこれらの従モノマーを単独で、或るいは2種

類以上を併用して用いられる。

前記主モノマーと上記従モノマーの組成比は、 得られる共重合体が臨界溶解温度を有し、かつその温度が80~0℃内に存在するような共重合比率でなければならない。具体的には、上記細胞付着性従モノマーの配合量は、その種類及び対象とする細胞種等によって異なるが、例えば、N-イソブロビルアクリルアミド等の主モノマーに対して、20▼1%以下であり、好ましくは、10▼1%以下である。20▼1%を超えると、得られる共重合体が0~80℃の範囲内に臨界溶解温度を示さなくなり好ましくない。

上記のように本発明に使用するポリマーは、一般に主モノマーと従モノマーを共重合することにより得られるが、増殖細胞の種類によって臨界帝解區度を調節する必要がある場合や、被覆物質と細胞培養支持体との相互作用を高める必要が生じた場合や、細胞支持体の親水・疎水性のバランスを調整する場合などは、上記以外のモノマー類を更に加えて得られる共重合体、他のポリマーと本

ても構わない。

被覆を施される基材の材質は、通常細胞培養に用いられるガラス、改質ガラス、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート等の高分子化合物、あるいはセラミックス、金属等が挙げられる。尚、基材表面はオゾン処理、ブラズマ処理、スパッタリング等の処理技術を用いて親水化を施されたものでも良い。形状は、ペトリディッシュに限定されることはなく、ブレート、ファイバー、(多孔質)粒子、また、一般に細胞培養等に用いられる容器の形状(フラスコ等)を付与されていても構わない。

基材へのポリマーの被覆方法は、基材と上記被 覆物質を①化学的な反応によって結合させる方法、 ②物理的な相互作用を利用する方法、を単独でま たは併用して行うことができる。被覆時にモノマーを使用する場合、そのモノマーは気体、液体、 固体いずれの状態でも良い。また、(コ)ポリマー を使用する場合にはおいても、そのポリマーは、 液体、固体状態のいずれの状態でも良い。これら 発明のポリマーとのグラフトまたはブロック共重合体、あるいは他のホモポリマー及び/又はコポリマーと本発明のポリマーとの混合物を用いてもよい。また、ポリマー本来の性質が損なわれない範囲で架構することも可能である。

上記主及び従モノマー以外のモノマー類としては、例えば(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸ブチル、スチレン等が挙げられる。

上記他のホモ及びコポリマーとしては、例えば ポリ(メタ)アクリル酸メチル、ポリ(メタ)アクリ ル酸エチル、ポリ(メタ)アクリル酸ブチル、ポリ スチレン等が挙げられる。

その他共重合に際しては、必要に応じ密剤(例 えば、メタノール、エタノール、イソプロビルア ルコール、トルエン、ペンゼン等)等を添加して もよい。

本発明の細胞培養用支持体は、適当な基材上に 上記ポリマーを被覆して得られるが、基材表面は 全面が被覆されていても、部分的に被覆されてい

のものを①化学的な反応によって結合させる場合、電子線照射(EB)、下線照射、紫外線照射、ブラズマ処理、コロナ処理、さらに細胞付着性基材と被覆材料が適当な反応性官能基を有する場合は、ラジカル反応、アニオン反応、カチオン反応等の一般に用いられる有機反応を用いることができる。②物理的な相互作用による方法としては、被覆材料単独または基材との相解性の良いマトリックスを媒体とし、強布、混練等の物理的吸着を用いる方法等があるが、これらに殴られるわけではない。

また、細胞支持体上にて培養した細胞を支持体から剥離させ回収するには、上限臨界溶解温度以上もしくは下限臨界溶解温度以下にするだけで良く、細胞を培養していた培養液においてもその他の等限液においても可能であり目的に合わせて選択することができる。

[作用]

本発明の細胞培養用支持体によれば、細胞増産 時には、細胞は細胞付着性基に接着し、効果的に 増殖をする。細胞剥離時には、下層部である臨界 存解復度が0~80℃の範囲にあるポリマーにおいて水分子の占める体積分率が上昇するため細胞は水中に溶離することになる。

以下本発明の作用を、主モノマーとしてN-ィ ソプロピルアクリルアミド、従モノマーとしてア クリル酸ナトリウム塩を用いた場合を例にとって、 より具体的に説明する。N-イソプロピルアクリ ルアミド/アクリル酸ナトリウム塩コポリマーは 水溶液中で約32℃に下限臨界溶解温度を有する。 例えば、一般に細胞培養用ペトリディッシュ材料 として用いられるポリスチレン基材上でN-イソ プロピルアクリルアミドとアクリル酸ナトリウム を電子纏照射(EB)により共重会を行なうとポリ スチレンは生成コポリマーにより被覆されるが、 下限臨界溶解温度である32℃以上ではこのコポ リマーはその占有体積が小さくなりコポリマー中 の水分子を排除して、支持体表面は疎水性を示す。 しかし、逆に32℃以下ではコポリマーの占有体 積は大きくなりコポリマー中の水分子の占める体 積分率が上昇し、支持体表面は観水性を示すよう

になる。従って個度を制御するだけで、支持体表 面の親水・蔵水性がコントロールでき細胞の支持 体への接着性が変化する。その結果温度を変化さ せるだけで培養・増殖後の細胞を破壊することな く細胞支持体から容易に剥離、回収することが可 能となるものと考えられる。

又アクリル酸ナトリウム塩で共重合させている ので、被覆された生成コポリマーは、細胞付着性 基を有する。そのため細胞を効率良く付着させ、 より多くの細胞を増殖させることが可能となる。

「発明の効果」

本発明に於いては、トリブシンやEDTAのような蛋白分解酵素や化学薬品等による処理を経ずに、細胞培養用支持体から培養細胞を剥離・回収することができるので、①処理工程が簡略化される、②不純物等の混入の可能性が完全になくなる、③増殖した細胞が化学的処理により細胞膜が障害されるということがなく、細胞本来の機能が損なわれない、④剥離した細胞が集合状態を保持している、⑤細胞の培養・回収を繰返し行なう事が出

来る等の有利な点を持つ。

更に、従来の細胞培養用支持体は一般にその支持体表面の状態に細胞の培養・回収機能が大きく依存するが、本発明によれば支持体の表面状態に左右されることなく機能が一様に発現するため、製品の品質が安定し、歩留りも良好となる上に細胞の種類に応じて最適な従モノマー種/配合量を選択することも可能となる。

〔実施例〕

以下、本発明を実施例により、より具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

(実施例1)

基材としてベクトン・ディキンソン・ラブウェア(Becton Dikinson Labware)社製ファルコン(FALCON)3002ペトリディッシュを用い、培養細胞としてウン大動脈血管内皮細胞を採用した。

ペトリディッシュ基材表面を被覆するために、 N-イソプロビルアクリルアミドを40wt%濃度

でエタノールに溶解させ、この中にアクリル酸を N-イソプロピルアクリルアミドに対し 1 wt %容 解させた。このエタノール容液 ().3 m2を3 () () 2ペトリディッシュ上に添加後、20Mradの電 子線を照射した。電子線照射終了後、イオン交換 水によりペトリディッシュを洗浄し、残存モノマ - 及びペトリディッシュ表面に結合していないコ ポリマーもしくはホモポリマーを取り除いた。次 に、ペトリディッシュ表面に被覆されたアクリル 酸成分内のカルボン酸を中和するため、10g1% 水酸化ナトリウム水溶液を3m2(カルボン酸残基 に対し過剰量)添加し、10分間静置し、その後 イオン交換水で十分にペトリディッシュ表面を洗 浄した。クリーンベンチ内で乾燥させ、さらにエ チレンオキサイド(EO)ガス滅菌を行ない。さら に十分脱気を行なうことより、本発明である細胞 培養支持体材料を得た。

ウシ大動脈血管内皮細胞の培養は、得られた細 随培養支持体材料上にて、ウシ胎児血清(FCS) を10%含むダルベッコー改変イーグル培地(D MEM)を培地として、5%二酸化炭素中、37 ℃で行なった。十分に細胞が増殖したのを確認し た後、培養液を5℃に冷却し、30分間放躍して、 付着/増殖細胞を剥離させ、増殖細胞剥離回収率 を下式に従って求めた。結果を表-1に示す。

剥離回収した 細胞総数 増殖細胞剥離回収率(%) = 増殖させた 細胞総数

(実施例2)

(実施例3)

アクリル酸の代わりにメタクリル酸ジエチルア ミノエチルをN-イソプロビルアクリルアミドに 対し1 vt%容解させる点以外は実施例1と同様に、 電子線照射およびイオン交換水による洗浄を行なっ た。このペトリディッシュにおいては中和は行な

剥離回収率を求めた。結果を表一」に示す。

(実施例6)

N-イソプロピルアクリルアミドの代わりにN-イソプロピルメタクリルアミドを利用し、アクリル酸をN-イソプロピルメタクリル酸をN-イソプロピルメタクリルアミドに対し0.3 ▼t%溶解させる点以外は実施例1と同様にして、細胞培養支持体を得た。このものに対しては45℃で細胞を培養し、以下は実施例1と同様にこれを剥離回収して、増殖細胞剥離回収率を求めた。結果を表-1に示す。

(実施例7)

N-イソプロビルアクリルアミドの代わりにN-n-プロビルアクリルアミドを利用し、またメタクリル酸ジエチルアミノエチルの代わりにメタクリル酸2-スルホエチルをN-n-プロビルアクリルアミドに対し10▼t% 溶解させる点以外は実施例3と同様にして、細胞培養支持体を得、その支持体上で細胞を培養しこれを剥離回収して、増殖細胞剥離回収率を求めた。結果を表-1に示

わず、そのままクリーンベンチ内で乾燥させ、さ らにEOガス酸菌を行ない、細胞培養支持体を得 な

細胞培養は実施例] と同様な方法で行ない、増 舶細胞剥離回収率を求めた。結果を表 - 1 に示す。 (字施例 4)

N-イソプロビルアクリルアミドの代わりにN-n-プロビルアクリルアミドを利用し、アクリル酸の代わりにメタクリル酸をN-n-プロビルアクリルアミドに対し」▼1%格解させる点以外は実施例1と同様にして、細胞培養支持体を得、その上で細胞を培養しこれを剥離回収して、増殖細胞剥離回収率を求めた。結果を表-1に示す。

(実施例5)

N-イソプロビルアクリルアミドの代わりにN.
N-ジェチルアクリルアミドを利用し、アクリル酸の代わりにメタクリル酸をN,N-ジェチルアクリルアミドに対し5♥t%溶解させる点以外は実施例1と同様にして、細胞培養支持体を得、その上で細胞を培養しこれを剥離回収して、増殖細胞

す。

(実施例8)

N-イソプロピルアクリルアミドの代わりにN-エトキシエチルアクリルアミドを利用し、またメタクリル酸ジエチルアミノエチルの代わりにアクリル酸3-スルホプロピルエステルをN-エトキシエチルアクリルアミドに対し0.5 vt%溶解させる点以外は実施例3と間様にして、細胞培養支持体を得、その支持体上で細胞を培養しこれを剥離回収して、増殖細胞剥離回収率を求めた。結果を表-1に示す。

(比較例1)

ベクトン・ディキンソン・ラブウェア社製ファルコン3002ペトリディッシュを、表面処理を全く行なわずにそのまま細胞培養支持体として用いた以外は、実施例1と同様な実験を行なった。結果を表~1に示す。

(比較例2)

基材としてベクトン・ディキンソン・ラブウェ ア社製ファルコン3002ペトリディッシュを用 い、被覆ポリマー用モノマーとしてN-イソブロビルアクリルアミドさらに架橋剤としてN,N-ーメチレンビスアクリルアミド(対N-イソブロビルアクリルアミド0.5 vt%)を用い、実施例1と同様にして支持体表面全体にポリマーを被覆し細胞支持体を得た。尚細胞付着性基を含有するモノマーは使用しなかった。このものを利用して実施例1と同様に細胞培養しこれを剥離回収し、増殖細胞剥離回収率を求めた。結果を表-1に示す。(比較例3)

アクリル酸をN-イソプロビルアクリルアミド に対し35 wt%溶解させ、固形分が40 wt%のエタノール溶液を利用する点以外は実施例1と同様にして、細胞培養用支持体を得、その支持体上で細胞を培養しこれを剥離回収して、増殖細胞剥離

回収率を求めた。結果を表ー」に示す。

表一!

	增殖細胞剥離回収率(%)
実施例	> 9 0
実施例2	>90
実施例3	> 9 0
実施例 4	> 9 0
実施例5	> 9 0
実施例6	> 9 0
実施例7	> 9 0
実施例8	> 9 0
比較例1	細胞が全く剥離せず(回収不可能)
比較例2	[細胞が付着/増殖せず]
比較例3	細胞が全く剥離せず(回収不可能)

なお、実施例、比較例とも支持体の親・疎水性を調べるためにフェース(FACE)接触角計(CA-D型)[協和界面科学株式会社製]および付属品として、三態系測定装置を用い、液滴法で接触角を測定した。結果を表-2に示す。

表 - 2

	3 7 ℃における 接触角(度)	5℃における 接触角(度)
実施例]	4 0	2 4
実施例2	4 1	2 4
実施例3	3 9	2 2
実施例 4	4 5	3 3
実施例5	4 2	2 3
実施例6	4 0 (45℃)	2 4
実施例7	4 4	3 1
実施例8	4 6	2 8
比較例!	5 7	6 3
比較例2	3 9	2 0
比較例3	4 0	3 9

表面処理を行なった実施例1、2、3、4、5、6、7、8では表-2に示されるように、支持体材料周囲の温度を37℃から5℃に下げることで接触角が減少しており、これは、被覆されたN-イソプロビルアクリルアミド、n-プロビルアクリルアミド、N,N-ジエチルアクリルアミド、

N-イソプロピルメタクリルアミドまたはN-エトキシエチルアクリルアミドと、それぞれの実施例で示される細胞付着性を有するモノマーとの共重合物により支持体材料表面が疎水性から親水性へと変化していることを示している。このような材料を使用した実施例 |、2、3、4、5、6、7、8の場合、表-|に示されるように、主に細胞付着性基に付着した細胞は、培養温度を低下させると培養支持体から良好に剥離し、回収することが可能であった。

一方、比較例1のように表面処理を施さない場合は、表-2に示されるように関りの温度を下げても接触角はほとんど変化せず、この支持体材料では表-1に示されるように、培養温度を低下させても付着細胞の剥離現象は、観察されず本発明での細胞培養支持体材料としては、不十分な性能であることが分かる。

さらに、比較例2のように支持体材料表面全体 にポリマーを被覆し、細胞付着性基を有するモノ マー成分が全く含まれない場合においては、表-

特開平4-126071 (8)

↓に示す通り、細胞は付着/増殖せず、本発明で の細胞培養支持体材料としては不十分な性能であ ることが分かる。

さらに、比較例3では、支持体材料表面への被 優部中に細胞付着性基を有するモノマー成分を含 む場合細胞は付着するが、その細胞付着性基を有 するモノマー成分量が多いため、表-2に示す通 り、支持体材料周囲の温度を37℃から5℃に下 げても、表面の親・疎水性は変化せず付着細胞の 剥離現象は観察されず、本発明での細胞培養支持 体材料としては不十分な性能であることが分かる。

以上の結果より本発明を実現するためには、細胞付着性基を有し、かつその状態で臨界裕解温度が存在するようなポリマーを被覆しなければならないことが分かる。

(実施例9)

実施例 1 で得られた剥離細胞の損傷度合を確認するため、これを遠心分離(600G,5分)より回収し、得られた2×10%個の細胞をベクトン・ディキンソン・ラブウェア社製ファルコン300

させることが可能であるが、比較例4では5倍までしか再増殖させることができなかった。このことは、本発明の剥離回収細胞は従来のそれよりも 損傷度が小さいことを意味する。

特許出顧人 花 王 株 式 会 社 学校法人 東京女子医科大学 代 理 人 弁理士 青山 葆 (ほか2名) 2ペトリディッシュ上で再び培養させた。細胞の培養は実施例1と同様の方法を採用した。結果を妻-3に示す。

(比較例4)

比較例1で培養した付着細胞を0.05%トリプシン-0.02%EDTAで処理し、剥離させた細胞の損傷度合を確認するためこれを遠心分離(600G.5分)することにより回収し、得られた2×10°個の細胞をベクトン・ディキンソン・ラブウェア社製ファルコン3002ペトリディッシュ上で再び培養させた。培養は、実施例1と同様な方法を採用した。結果を表-3に示す。

表 -- 3

	培養開始時の 細胞数(個)	4.日後の 細胞数(個)
実施例9	2 × 1 0 °	2.5×10 °
比較例4	2 × 1 0 6	1 × 1 0 *

実施例 9 および比較例 4 の結果から剥離回収細 胞の損傷度合については、表 - 3 に示されるよう に、実施例 9 では培養開始時の 1 3 倍まで再増雇

手続補正書

平成 3年 8月 1日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

平成 2年 特許顧 第248454号

2. 発明の名称

細胞培養用支持体

3、補正をする者

事件との関係 特許出願人 名称 花王株式会社

(他1名)

4. 代 理 人

住所 〒540 大阪府大阪市中央区域見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー内 電話(06)949-1261 FAX(06)949-0361

氏名 弁理士 (6214) 青 山

葆

記号記

5. 補正命令の日付

自 発

6、補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の標



7. 補正の内容

(1)明細書第10頁下から第8行~第7行、「含有するモノマー」の後に「「例えば、(メタ)アクリル酸ステアリル、(メタ)アクリル酸ラウリル、アクリル酸2エトキシエチル、アクリル酸ポリエチレングリコール、メタクリル酸ポリブロビレングリコール、アクロレイン、メタクロレイン、酢酸ビニル、酢酸アリル、メタクリル酸2ーシアノエチル、メタクリル酸2ーニトロエチル、oーニトロフェニルメタクリレート、Nー[1-(4-クロロフェニル)エチル」メタクリルアミド、アクリル酸2ークロロエチル、(メタ)アクリル酸ブリンジル、(メタ)アクリル酸アリル、メタアクリル酸アリルオキシメチル等]」を挿入する。

(2)同第11頁第4行、「80~0」とあるを「0~80」に訂正する。

以上